

Inhalt

		Seite
<i>R. Feiertag</i>	Begrüßung	1
<i>D. Sofronijevic</i>	Einleitung	3
<i>M. Maul</i>	Lacke für die Maskentechnik	9
<i>A. Oelmann</i>	Automatisierung in der Maskentechnik	39
<i>U. Böttiger und B. Hafner</i>	Patterngenerator mit Excimer-Laser	59
<i>H. Wahlers</i>	Fortschritte in der Inspektion und Reparatur von Reticles	75
<i>D. Sofronijevic</i>	Einleitung	85
<i>D. Sofronijevic</i>	Kathodenmasken für die 1 : 1 Elektronen-Projektion	89
<i>S. Pongratz</i>	Röntgenmasken für Proximity 1 : 1	93
<i>A. Oelmann</i>	Masken für Elektronen-Proximity 1 : 1	115
	Masken für Elektronen Stepper 1 : 1	115
<i>H. Löschner, E. Hammel, G. Stengl, H. Kraus, G. Stangl und K. Lübke</i>	Masken für Ionen-Proximity 1 : 1 und für Ionenstepper x : 1	125
<i>K.-H. Müller</i>	Inspektion und Reparatur nicht lichtoptischer Masken	143
<i>H. Feindt</i>	Ein neues Verfahren zur hochgenauen Messung von Strukturbreiten und XY-Koordinaten	147
<i>R. Feiertag</i>	Schlußwort	167